

2021 年 6 月 28 日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社
東証第1部コード6920
横浜市港北区新横浜2-10-1

代表者名 代表取締役社長 岡林 理
発表担当 経営企画室 室長 三澤 祐太郎

新製品 マスクエッジ検査装置 **MZ100 を発表**

【概 要】

この度レーザーテックは、先端半導体用フォトマスクの高品質化、製造歩留まり向上に貢献するフォトマスクエッジ部の検査に対応した MZ100 を製品化しました。

【内 容】

レーザーテックは、EUV および DUV フォトマスクのエッジ部における高感度検査、レビュー、計測を可能とするマスクエッジ検査装置「MZ100」を製品化しました。

半導体デバイス市場では 5G や HPC 向けをはじめとする需要増大が続いており、半導体デバイス製造工程では継続的に微細化による性能向上が求められています。そのため、半導体デバイスの製造工程においてもより高品質のマスクブランクス、フォトマスクの製造が要求されます。

「MZ100」では従来管理のなされていなかったマスクエッジ部のサイド面、ベベル部の欠陥検査や製造プロセス変動の管理を可能とすることで、フォトマスク製造プロセスの歩留まり向上や高品質化に寄与することができます。

本装置では当社のコア技術であるコンフォール光学系、先端フォトマスク検査装置で培った検査、マスクハンドリング技術、ウェハエッジ検査装置 EZ300 の光学系機構を統合することでフォトマスクエッジ部の検査を実現することを可能としました。

当社では今後も、先端半導体メーカーのご要望にお応えし、フォトマスクの製造プロセスの品質改善、歩留まり向上へ向けて貢献してまいります。

【特 長】

- 先端半導体向け EUV および DUV フォトマスクへ対応
- コンフォーカル光学系を用いた高感度検査、高精度の測定が可能
- フォトマスクのエッジ部(サイド面、ベベル)に対応

【用 途】

- EUV および DUV フォトマスクのエッジ部欠陥検査
- 欠陥レビュー
- 欠陥サイズ、高さ測定
- 各種プロセス変動のモニター



マスクエッジ検査装置 MZ100

◇お問い合わせ先◇

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第3ソリューションセールス部 山内 勝希

TEL:045-478-7337 FAX:045-478-7333

E-mail:masaki.yamauchi@lasertec.co.jp